

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【公開番号】特開2016-97387(P2016-97387A)

【公開日】平成28年5月30日(2016.5.30)

【年通号数】公開・登録公報2016-033

【出願番号】特願2014-238637(P2014-238637)

【国際特許分類】

C 02 F 1/46 (2006.01)  
C 02 F 1/66 (2006.01)

【F I】

C 02 F	1/46	Z
C 02 F	1/66	5 1 0 G
C 02 F	1/66	5 3 0 C
C 02 F	1/66	5 3 0 Q
C 02 F	1/66	5 4 0 E
C 02 F	1/66	5 2 2 A

【手続補正書】

【提出日】平成29年11月9日(2017.11.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ボイラ排水を混合槽へ供給する排水ラインと、

前記排水ラインを流れる前記ボイラ排水のpHを測定するpH測定装置と、

前記排水ライン上に設けられ、前記ボイラ排水に前記ボイラ排水のpHを調整するpH調整剤を添加するpH調整装置と、

海水又は塩水を電気分解して次亜塩素酸を有する電解処理水を生成する電解装置と、

前記排水ラインと前記混合槽との合流部より上流に設けられ、前記電解装置で生成された次亜塩素酸を前記ボイラ排水に供給する供給ラインと、

前記pH測定装置の測定値に基づいて前記pH調整剤の添加量を制御する制御装置と、を有し、

前記pH調整装置は、前記排水ライン上において、前記合流部よりも上流側で前記ボイラ排水のpHを調整するアンモニア処理システム。

【請求項2】

前記pH測定装置は、前記pH調整装置の下流側であって、前記pH調整装置によって添加された前記pH調整剤によって調整された前記ボイラ排水のpHが安定する位置に配置されている請求項1に記載のアンモニア処理システム。

【請求項3】

前記排水ラインの上流側に設けられて前記ボイラ排水を貯留する貯留槽と、

前記貯留槽に貯留された前記ボイラ排水のpHを測定する貯留槽pH測定装置と、を有し、

前記制御装置は、前記貯留槽pH測定装置の測定値に基づいて前記電解装置にて生成される次亜塩素酸量を制御する請求項1又は請求項2に記載のアンモニア処理システム。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明の第一の態様によれば、アンモニア処理システムは、ボイラ排水を混合槽へ供給する排水ラインと、前記排水ラインを流れる前記ボイラ排水のpHを測定するpH測定装置と、前記排水ライン上に設けられ、前記ボイラ排水に前記ボイラ排水のpHを調整するpH調整剤を添加するpH調整装置と、海水又は塩水を電気分解して次亜塩素酸を有する電解処理水を生成する電解装置と、前記排水ラインと前記混合槽との合流部より上流に設けられ、前記電解装置で生成された次亜塩素酸を前記ボイラ排水に供給する供給ラインと、前記pH測定装置の測定値に基づいて前記pH調整剤の添加量を制御する制御装置と、を有し、前記pH調整装置は、前記排水ライン上において、前記合流部よりも上流側で前記ボイラ排水のpHを調整することを特徴とする。